

EXYRIA® (エクシリア) 高純度イットリア (Y₂O₃) セラミックス

“EXYRIA” High Purity Yttria Ceramics

“EXYRIA®”は、半導体デザインの微細化にともなうパーティクル・不純物汚染低減要求に対するソリューションとして開発したバルク・イットリアセラミックスです。

“EXYRIA” is high purity bulk yttria ceramics for semiconductor process parts to meet the market trend and requirement to reduce the particle generation and metal contamination.

特長 Features

耐プラズマ性に優れた材料です Higher plasma resistance

- プラズマによる消耗量は石英の1/100、アルミナの1/10程度です。
The etch rate is about 1/100 of Quartz, 1/10 of Alumina.
- パーツ交換時間頻度を減らせます。
Saving the maintenance.

ランニングコストの削減が図れます！
Saving the running cost !

大型パーツの製造が可能です。 Applicable for large-sized parts.

アルミナパーツと同様の精密加工が可能です。 “EXYRIA” can be a substitute for alumina parts, without any major design changes.

EXYRIA® 製造可能寸法 Max. available size φ550×25mm

EXYRIA® 用途例 Applications

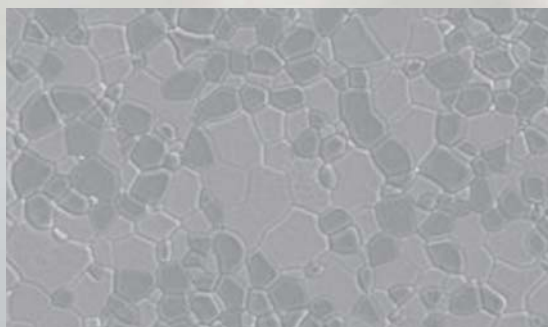
シャワープレート、サセプター、
インシュレーター、ノズル、
金属ネジ保護キャップ etc
Shower plate, wafer holder,
Insulator, gas nozzle,
protective cap for metal screw, etc.

イットリア溶射 Y₂O₃ spray coating

各種基材へのイットリア溶射も可能です。
最大製造可能寸法: 1000×1000mm
(膜厚150~250μm)
Spray coating is also available on several
substrates with max. size 1000x1000mm
(150~250μm film thickness)

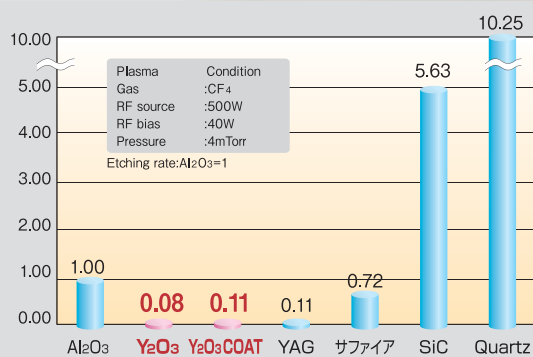
お客様のニーズに対応するため、
さまざまなグレードを開発しています。
We have been developing various grades
for further demands.

EXYRIA® 結晶組織 Microstructure



均一な結晶組織
Uniform crystal structure

各種材料の耐Fプラズマ性 F-plasma resistance



COVALENT

コバレントマテリアル株式会社

セラミックス事業本部
東京都品川区大崎1-6-3 日精ビルディング 〒141-0032
Tel:03-5437-8409 Fax:03-5437-7395
www.covalent.co.jp